

半導体にイノベーションをもたらす多能性[®]中間膜^{*}の社会実装を目指す
「株式会社 Gaianixx」への出資について

2024年3月6日

JIC ベンチャー・グロース・インベストメンツ株式会社が運営する、JIC ベンチャー・グロース・ファンド 2号投資事業有限責任組合は株式会社 Gaianixx（本社：東京都文京区、代表取締役社長 CEO：中尾健人、以下 GNX）へ出資を実行したことをお知らせいたします。

GNX は多能性中間膜及びエピタキシャル^{**}の研究開発・製造・販売する東京大学発ディープテックベンチャー企業です。日本を始め世界では今後デジタル社会の更なる普及とそれに伴う電力消費の増大が示唆されており、半導体の高性能化と電力消費量の削減は喫緊の課題です。当社は独自の中間膜を用いることで、従来は難しいとされてきた高品質な薄膜化を実現可能です。従来品と比して半導体を高性能化することで、次世代の電子デバイスやセンサー、エネルギーハーベスティングの基盤となる可能性を秘めています。既に複数の事業会社とも連携済みであり、今後は上市に向けた研究開発の推進、及び新たな半導体を拡充し社会実装を目指します。

本投資の意義は、GNX が日本発の多能性中間膜を社会実装すること、並びに半導体高性能化によりデジタル社会の普及と電力消費量の削減に寄与することです。

本投資資金により、GNX の研究開発を加速させ、日本発の多能性中間膜の社会実装を支援するとともに、日本のディープテックベンチャーエコシステムの活性化に貢献することを目指します。

*多能性中間膜：基盤と半導体膜の格子不整合を駆動力として双晶型マルテンサイト変動を生じ、格子不整合を緩和し上部半導体膜を高品質結晶化させる GNX 独自の中間膜。

**エピタキシャル成長：結晶基盤の上に結晶成長を行い、基盤の結晶面に揃えて単結晶の薄膜を配列する成長機構。

記載されている情報は、発表日現在の情報です。予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。

本件に関するお問い合わせ先

JIC ベンチャー・グロース・インベストメンツ株式会社

E-mail : info@j-vgi.co.jp